교육생 모집 (기본과정/특화과정)

● 교육명 : 경기도 반도체 산업 전문인력 양성 과정(기본과정/특화과정)

● 교육목적 : 경기지역 반도체 산업의 중·장기적 기술 경쟁력 확보를 위한 반도체 인력의 기술력 향상 및 채용연계 지원

● 교육장소 : 성균관대학교 수원캠퍼스(제1종합연구동 4층 교육실 및 나노공정팹)

● 교육 모집인원 및 대상

기본과정 : 과정당 20명
특화과정 : 과정당 20명

3) 교육대상 : 경기도 소재 중소·중견 반도체 관련기업 재직자, 채용 확정자(확인서 첨부)

● 교육일정

1) 기본과정

과정명	교육일자	
반도체 공정기술과정(1차)	2021. 04. 14.(수) ~ 04. 16.(금) [3일]	
반도체 공정기술과정(2차)	2021. 05. 12.(수) ~ 05. 14.(금) [3일]	
반도체 공정기술과정(3차)	2021. 07. 07.(수) ~ 07. 09.(금) [3일]	

2) 특화과정

과정명	교육일자	
반도체 Photo Etch 공정 특화과정(1차)	2021. 04. 12.(월) ~ 04. 13.(화) [2일]	
반도체 플라즈마 공정 특화과정	2021. 04. 21.(수) ~ 04. 23.(목) [3일]	
반도체 Photo Etch 공정 특화과정(2차)	2021. 05. 27.(목) ~ 05. 28.(금) [2일]	
디스플레이 반도체 공정 특화과정	2001. 06. 10.(목) ~ 06. 11.(금) [2일]	
반도체 PKG 공정 특화과정	2001. 06. 24.(목) ~ 06. 25.(금) [2일]	

* 상기 교육일정은 사정에 따라 변경될 수 있음

● 교육비 : 무료 (교재 포함), 중식 제공 / 주차비 지원

● 신청방법 : 첨부된 교육신청서 작성 후 이메일로 제출

● 신청기한 : ~ 2021. 03. 31.(수)까지 (선착순 마감, 기업별 최대 5명까지 신청가능)

● 신청서 제출 및 문의처 : 성균관대학교 지역혁신센터 김용태 팀장

(E. kimyt@skku.edu /T. 031-290-5648)

● 기타 : 기본, 특화과정 각각 중복 신청이 가능하며, 신청자가 많을 경우 단일신청 우선 코로나19에 대한 정부방역지침 상 또는 거리두기 2.5단계 시 비대면 교육으로 진행예정





<세부 교육프로그램>

■ 반도체 공정기술과정 (3일)

일수	시간표	강좌명	강사
1일차	09:00~11:00	반도체 식각공정	채희엽 교수(성균관대)
	11:00~13:00	반도체 도금 및 평탄화 공정	유봉영 교수(한양대)
	14:00~16:00	반도체 사진공정	박인성 교수(한양대)
	16:00~18:00	반도체 증착공정	박태주 교수(한양대)
2일차 -	09:00~11:00	반도체 소자의 이해 : 로직 및 메모리 소자	박진홍 교수(성균관대)
	11:00~13:00	반도체장비산업의 현황 및 비젼	안기현 전무(KSIA)
	14:00~16:00	반도체 패키징 기술	이후정 교수(성균관대)
	16:00~18:00	반도체 산화 및 도핑 공정	김형섭 교수(성균관대)
3일차	9:00~18:00	반도체 공정실습	RIC

■ 반도체 Photo Etch 공정 특화과정 (2일)

일수	시간표	강좌명	강사
1일차	09:00~11:00	사진 기술 기초	강지훈 교수(국민대)
	11:00~13:00	노광 공정 (EUVL 포함)	박인성 교수(한양대)
	14:00~16:00	EUVL 소재부품장비	박인성 교수(한양대)
	16:00~18:00	Etch 공정의 기술	채희엽 교수(성균관대)
	09:00~11:00	플라즈마 식각 기술 (RIE)	채희엽 교수(성균관대)
2일차	11:00~13:00	플라즈마 원자층 식각 기술	염근영 교수(성균관대)
	14:00~18:00	Photo 및 Etch 공정실습	RIC





■ 반도체 플라즈마 공정 특화과정 (3일)

일수	시간표	강좌명	강사
1일차	09:00~11:00	플라즈마내 화학 기초	김창구 교수(아주대)
	11:00~13:00	PECVD공정	김창구 교수(아주대)
	14:00~16:00	플라즈마 물리기초	정진욱 교수(한양대)
	16:00~18:00	플라즈마 소스	정진욱 교수(한양대)
2일차	09:00~11:00	ALD/PEALD 공정	채희엽 교수(성균관대)
	11:00~13:00	플라즈마 식각 기술 (RIE)	채희엽 교수(성균관대)
	14:00~16:00	플라즈마 원자층 식각 기술	염근영 교수(성균관대)
	16:00~18:00	플라즈마 증착/식각 실습	RIC
3일차	09:00~11:00	RF 기술 기초	유신재 교수(충남대)
	11:00~13:00	임피던스 매칭 기술	유신재 교수(충남대)
	14:00~16:00	플라즈마 진단기술	채희엽 교수(성균관대)
	16:00~18:00	플라즈마 진단 실습	NPL

■ 반도체 PKG 공정 특화과정 (2일)

일수	시간표	강좌명	강사
1일차	09:00~11:00	전자패키지 소재 및 부품기술동향	정승부 교수(성균관대)
	11:00~13:00	다양한 Interconnection 소재와 공정기술	최광성 박사(ETRI)
	14:00~16:00	다양한 전자패키지 부품 제조기술	좌성훈 교수(서울과기대)
	16:00~18:00	전장모듈의 패키지 공정 및 기술동향	윤정원 교수(충북대)
2일차	09:00~11:00	이종소재의 표면처리 및 솔더링기술	김정수 박사(한국생기원)
	11:00~13:00	전자패키징을 위한 차세대 PCB기술	정재우 교수(성균관대)
	14:00~18:00	전자부품 신뢰성 평가 및 실습	RIC/MSPL

■ 디스플레이 반도체 공정 특화과정 (2일)

일수	시간표	강좌명	강사
	09:00~11:00	차세대 산화물 TFT 소재기술	조형균 교수(성균관대)
4 OI ±I	11:00~13:00	차세대 유연 디스플레이 소재 기술	김한기 교수(성균관대)
1일차	14:00~16:00	LCD 재료/ 소자의 이해	최석원 교수(경희대)
	16:00~18:00	차세대 Quantum dot 디스플레이 소재/소자기술	배완기 교수(성균관대)
09:00~11:00		OLED 소재기술	김한기 교수(성균관대)
2일차	11:00~13:00	투명 디스플레이 기술	김한기 교수(성균관대)
	14:00~18:00	디스플레이 공정 및 설비교육	RIC





교육참가 신청서

※ 신청하시는 과정별 각각 신청서 제출해주세요

x count 102 11 con Manima					
회사명					
회사주소					
과정명					
	직 위	성명(성별)	생년월일	휴대전화	이메일
참가자 명 단					
	총			명	

성균관대학교 지역혁신센터(RIC) 센터장 귀하





<교육장 오시는 길>



※ 주소 : 경기도 수원시 장안구 서부로 2066 성균관대학교 제1종합연구동 4층



